

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 17 年 6 月 16 日 (2005.6.16)

【公開番号】特開 2001-151936 (P2001-151936A)

【公開日】平成 13 年 6 月 5 日 (2001.6.5)

【出願番号】特願 平 11-331574

【国際特許分類第 7 版】

C 0 8 L 1/12

C 0 8 J 5/18

C 0 8 K 3/36

G 0 2 B 5/30

// C 0 8 L 1:12

【F I】

C 0 8 L 1/12

C 0 8 J 5/18 C E P

C 0 8 K 3/36

G 0 2 B 5/30

C 0 8 L 1:12

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 9 月 22 日 (2004.9.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

セルローストリアセテートフィルムにおいて少なくとも表面層が平均粒径が 0.5 μ m 以上で 1.0 μ m 未満である二酸化ケイ素微粒子を 0.10 質量% ~ 0.15 質量% 含有することを特徴とするセルローストリアセテートフィルム。

【請求項 2】

2 層以上の層からなるセルロースアセテートフィルムにおいて、表面層が内部層よりも二酸化ケイ素微粒子を多く含むことを特徴とする請求項 1 に記載のセルロースアセテートフィルム。

【請求項 3】

該フィルムが偏光膜の保護フィルムである請求項 1 に記載のセルローストリアセテートフィルム。

【請求項 4】

少なくともセルロースアセテートと溶媒を含むセルロースアセテートのドープに、二酸化ケイ素微粒子を添加して混合する工程を有するセルロースアセテートフィルムの製造方法であって、ドープに添加する前に前記微粒子を分散させてその粒径を制御する工程を有することを特徴とするセルロースアセテートフィルムの製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記課題を解決するため種々検討を重ねた結果、セルローストリアセテートフィルムを製膜する際に、少なくともその表面層に特定粒径の二酸化ケイ素微粒子を所定濃度で含有させることにより、巻き取り時の接着防止効果が著しく高め得ることを見出し、この知見に基づき本発明をなすに至った。

すなわち本発明は

(1) セルローストリアセテートフィルムにおいて少なくとも表面層が平均粒径が0.5 μm 以上で1.0 μm 未満である二酸化ケイ素微粒子を0.10質量%～0.15質量%含有することを特徴とするセルローストリアセテートフィルム、

(2) 2層以上の層からなるセルロースアセテートフィルムにおいて、表面層が内部層よりも二酸化ケイ素微粒子を多く含むことを特徴とする請求項1に記載のセルロースアセテートフィルム、

(3) 該フィルムが偏光膜の保護フィルムである(1)項に記載のセルローストリアセテートフィルム、及び

(4) 少なくともセルロースアセテートと溶媒を含むセルロースアセテートのドーブに、二酸化ケイ素微粒子を添加して混合する工程を有するセルロースアセテートフィルムの製造方法であって、ドーブに添加する前に前記微粒子を分散させてその粒径を制御する工程を有することを特徴とするセルロースアセテートフィルムの製造方法
を提供するものである。